

日程表 (会場別) I

立命館大学

会場	収容数	8月29日 (火)		8月30日 (水)		8月31日 (木)		9月1日 (金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
プリズムハウス	A 1F-P101	480	「カーボンナノチューブの最新動向」		合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」				
	B 1F-P102	480	13.3 III - V 族エピタキシャル結晶	13.3 III - V 族エピタキシャル結晶	「ボトムアップ成長技術のマイルストーンとナノエピタキシャルへの展開」		14.1 基礎物性・評価	「微小球フォトエレクトロニクスの新展開」	14.1 基礎物性・評価	
	C 1F-P103	480	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶		13.4 III - V 窒化物結晶	
	D 1F-P104	776	【講演奨励賞贈呈式】	特別シンポジウム 「我が国の科学技術研究開発の推進と応用物理学会 - 何が要請されているか、それによって応答するか -」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」
	E 1F-P105	906	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶	<IM 結晶会員のついで> 結晶工学分科会企画シンポジウム「窒化物半導体を用いた増長長光デバイス」	13.4 III - V 窒化物結晶	13.4 III - V 窒化物結晶
	F 1F-P111	78	9.1 基礎物性	9.1 基礎物性	9.5 アナログ応用および関連技術	9.5 アナログ応用および関連技術		15.7 磁場応用	9.6 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	
	G 1F-P112	78	9.2 新材料、新薄膜、新低温動作デバイス	9.4 臨界電流、超伝導パワー応用	15.5 エネルギー変換・貯蔵 15.6 資源・環境	2.3 計測標準	2.2 精密計測・ナノ計測	2.1 計測・制御技術		
	H 2F-P201	480	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス 【分科内招待講演】	12.5 半導体光物性・光デバイス	多元系機能材料研究会企画「多元系半導体の設計、作製、および応用 - 新しい展開は何か -」	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス		
	K 2F-P202	480	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	「実用期を迎えたクラスターイオンビーム技術」	7.5 ビーム・光励起表面反応	7.5 ビーム・光励起表面反応		
	L 2F-P203	480		「レーザー・プロセスングとバイオの融合」	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	「熱電発電システム最前線 ~ 熱電変換は地球を救うか? ~」		
フォレストハウス	M 1F-F102	78	15.1 応用物理一般	15.4 トライボロジー 15.3 新技術	8.1 磁性材料・磁気デバイス	8.2 誘電材料・誘電体	8.6 新機能材料・新物性	8.4 ナノエレクトロニクス <JJAP 論文賞>		
	N 1F-F103	215	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.3 電子機能材料・デバイス	10.3 電子機能材料・デバイス	【M&BE 論文賞受賞記念講演】 10.3 電子機能材料・デバイス	
	P 1F-F104	215		10.5 液晶	1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー	10.6 高分子・ソフトマテリアル	3.8 近接場光学	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス	10.4 光機能材料・デバイス
	Q 1F-F106	78	1.4 プラズマ応用プロセス	1.4 プラズマ応用プロセス	1.3 反応性プラズマの診断と計測	1.3 反応性プラズマの診断と計測	9.3 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長		1.6 プラズマ現象一般	1.6 プラズマ現象一般
	R 1F-F107	215	3.2 材料光学	3.2 材料光学	1.1 放射線・加速器・原子炉	放射線分科会企画「中性子計測技術の最近の展開」	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉	1.1 放射線・加速器・原子炉
	S 1F-F108	215	3.7 生体・医用光学	3.7 生体・医用光学	1.7 プラズマエッチング	1.7 プラズマエッチング			1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源
	T 2F-F201	215		3.9 光学新領域	3.8 近接場光学 <JJAP 論文賞>	3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学 <JJAP 論文賞>		
	V 2F-F202	215	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜 <JJAP 論文賞>	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜		
	W 2F-F203	215	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー
	X 2F-F204	215	合同セッションD 「プラズマCVDの基礎と応用」	合同セッションD 「プラズマCVDの基礎と応用」	14.2 プロセス技術	14.2 プロセス技術 14.3 デバイス	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	
	Y 2F-F205	215	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	6.6 ブローブ顕微鏡	6.6 ブローブ顕微鏡	6.6 ブローブ顕微鏡	6.6 ブローブ顕微鏡 <JJAP 論文奨励賞>		
	ZA 2F-F206	215	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	「光とカオス - 応用最前線 -」	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 <JJAP 論文賞>	4.6 レーザー分光応用・計測	
	ZB 3F-F301	215		合同セッションG 「量子情報の基礎と応用」	7.1 X線技術	7.1 X線技術 <JJAP 論文奨励賞>	12.4 超高速・機能デバイス	12.4 超高速・機能デバイス 【分科内招待講演】	12.4 超高速・機能デバイス <JJAP 論文賞>	12.4 超高速・機能デバイス
ZC 3F-F302	215	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術	10.1 作製技術			

日程表 (会場別) 2

立命館大学

会場	収容数	8月29日(火)		8月30日(水)		8月31日(木)		9月1日(金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
フォレストハウス	ZD 3F-F303	215	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象	4.2 フォトニックナノ構造・現象		
	ZE 3F-F304	215	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」	合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」
	ZF 3F-F305	215	13.7 エピタキシーの基礎	13.1 バルク結晶成長	13.2 II-VI族結晶	13.2 II-VI族結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶		
	ZG 3F-F306	215	13.8 結晶評価、ナノ不純物・結晶欠陥	13.8 結晶評価、ナノ不純物・結晶欠陥	13.6 IV族系化合物	13.6 IV族系化合物	13.6 IV族系化合物<解説論文賞>	13.5 IV族結晶、IV-IV族混晶		
カラーニングハウスI	ZH 1F-C101	727	10.9 特定テーマA有機トランジスター	10.9 特定テーマA有機トランジスター	10.9 特定テーマA有機トランジスター	【M&BE 奨励賞受賞記念講演】10.9 特定テーマA有機トランジスター	10.9 特定テーマA有機トランジスター	「 π 共役高分子の超階層制御と革新機能の探索」	10.9 特定テーマA有機トランジスター	10.9 特定テーマA有機トランジスター
	ZK 1F-C102	583	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	「スピントロニクス」の萌芽的研究と実用化研究最前線	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」	合同セッションE「スピントロニクス・ナノマグネティクス」<JJAP 論文奨励賞>		
	ZL 1F-C104	196	「X線・中性子による quick 反射率法の展望 - 表面や埋もれたナノ構造の変化を追う(II)」		7.8 ビーム応用一般・新技術	「応用物理教育教材開発の現状と課題」		<IM 人材育成・男女共同参画 第8回ミーティング>		
	ZM 1F-C105	196	3.1 物理光学・光学基礎 3.6 視覚・色彩	「高度映像情報処理・表示技術の新展開」	3.5 情報光学	3.5 情報光学	7.7 微小電子源	7.7 微小電子源		
	ZN 1F-C106	196	11.2 半導体表面	11.2 半導体表面	11.4 配線技術	11.4 配線技術	11.4 配線技術	11.1 基礎物性・評価		
	ZQ 1F-C108	398	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術	11.5 Si プロセス技術		
	ZR 1F-C109	398	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.6 Si デバイス/集積化技術	11.7 シミュレーション		
	ZS 2F-C201	727		「ナノテクノロジーを活用した次世代生命工学」	「次世代エネルギーを担う有機系太陽電池」		応用電子物性分科会、非晶質・微結晶分科、応用物理一般分科合同企画「太陽電池の今と未来」			
	ZT 2F-C202	583	5.1 半導体レーザー・発光素子		5.1 半導体レーザー・発光素子	日本学術振興会第161委員会企画「新バルク結晶をものにするための基礎技術を考える - 無酸から有機へと集く高性能、低欠陥化技術 -」	5.2 光検出	「光インターコネクション(II)」		
	ZV 2F-C203	583		薄膜・表面物理分科会企画「これまでわからなかった表面分析技術の極限化」	10.8 有機EL	10.8 有機EL	10.8 有機EL	10.8 有機EL<JJAP 論文奨励賞>		
	ZW 2F-C204	583	11.4 配線技術分科内総合講演「LSI 多層配線の発展史と最先端技術」			「SiO ₂ から High-k 絶縁膜の材料科学と界面物理」		【プラズマ賞記念講演】プロセスモニタリングとしてのプラズマ計測技術—先進プロセス制御を目指して—		
	ZX 2F-C205	398	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.3 光記録	5.4 光制御	5.4 光制御
	RA 2F-C206	398	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	6.3 酸化物エレクトロニクス	
	RB 3F-C303	583	5.5 光ファイバー	5.5 光ファイバー	10.10 特定テーマB 生体分子計測・バイオナノテクノロジー<解説論文賞>	「高度バイオセンシングの新しい潮流」	10.10 特定テーマB 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	10.10 特定テーマB 生体分子計測・バイオナノテクノロジー		
	RC 3F-C304	583	7.4 ナノインプリント	「ナノインプリント技術の現状と動向」	7.4 ナノインプリント	7.3 リソグラフィ 7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	「ArF 液浸リソグラフィ」	
	RD 3F-C305	398	12.3 プロセス技術・界面制御	12.3 プロセス技術・界面制御		シリサイド系半導体と関連物質研究会合同企画シンポジウム「シリサイド半導体研究10年の進捗」	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性【分科内招待講演】	12.1 探索的材料物性	
RE 3F-C306	398				12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造<解説論文賞>	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	
ローム記念館 5F-大会議室	223		【評議員・代議員合同会議】 【論文賞授賞式】	第39回応用物理学会スクール「最近のマイクロ・ナノ微細加工技術とMEMSの産業応用」		第39回応用物理学会スクール「進化するディスプレイ技術-現状とさらなる発展に向けて-				
BKジム	ポスター	4.7 レーザー・プロセス 6.4 薄膜新材料	(前半) 6.4 薄膜新材料	11.3 絶縁膜技術 15.2 教育	(前半) 4.7 レーザー・プロセス 10.7 生物・医用工学・バイオチップ	11.3 絶縁膜技術 12.5 半導体光物性・光デバイス	(前半) 11.3 絶縁膜技術	8.3 微粒子・粉体 12.5 半導体光物性・光デバイス	(後半) 6.4 薄膜新材料	(後半) 4.7 レーザー・プロセス